

EMS hotplate 1000-1 使用規定：

使用者：需要精準控制溫度且利用 vacuum 吸附晶片的使用者可申請使用。

使用規定：

- (1) 使用時須登記，並於機台旁板子註明(a.)使用者姓名、(b.)加熱溫度、(c.)使用時間、(d.)光阻種類，並寫記錄簿。
- (2) 使用後須等熱盤冷卻，以該光阻之去光阻液將殘餘光阻清理乾淨(無去光阻液之光阻禁止在此烤盤使用，例如 SU-8...等)。熱盤表面有 coating 層，嚴禁以金屬工具清理。

若有違反上述規定者，一律停權三個月並負責清理加熱平盤使其回復原狀。無法恢復者將通知計畫主持人照價賠償。

目前可以在此烤盤烘烤的光阻如下

光阻名稱	去光阻液	常用烘烤條件
S1813	Acetone	110° 1.5min.
LOR	Remover PG	180° 5min.
PMMA	Acetone	135° 10min (4A)
PMMA-MMA	Acetone	135° 5min.
ZEP520	ZD-MAC	180° 3min.
Espacer	Water	100° 10min.